

Bibliographic data: KR 20040049025 (A)

INTEGRATED LIGHT SOURCE

Publication date: 2004-06-11 Inventor(s): KIM KEE CHUN + Applicant(s): KIM KEE CHUN +

- international:

Classification: - European:

Application number: KR20020076159 20021203 Priority number(s): KR20020076159 20021203

Abstract of KR 20040049025 (A)

PURPOSE: An integrated light source is provided to generate parallel beams having various areas and various shapes by arranging closely light source units including parabolic mirrors. CONSTITUTION: An integrated light source includes a plurality of light source units. Each light source unit is formed with a parabolic mirror and a light emission body. The parabolic mirrors of the light source units are arranged closely to each other. Each front side of object lenses of the parabolic mirrors is formed with shapes of regular triangles, shapes of regular squares, and shapes of regular hexagons in order to reduce volumes of the light sources and generate parallel beams.

Last updated: 26.04.2011 Worldwide Database 5.7.22: 93p

F21L4/02: (IPC1-7): F21L4/02

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl. 7 H01L 21/027 (11) 공개번호 특2002 - 0076159

(43) 공개일자 2002년10월09일

(21) 출원번호 (22) 출원일자 10 - 2002 - 0016281 2002년03월26일

(30) 우선권주장

IP-P-2001-00090646 2001년03월27일

일본(IP)

(71) 출원인

가부시키가이샤 니콘

일본 도꾜도 지요다꾸 마루노우찌 3쵸메 2방 3고

(72) 발명자

시게마츠고지

일본도쿄도지요다쿠마루노우치3쵸메2 - 3가부시키가이샤니콘내

미즈사와마사유키

일본도쿄도지요다쿠마루노우치3쵸메2 - 3가부시키가이샤니콘내

후지시마요우헤이

일본도쿄도지요다쿠마루노우치3쵸메2 - 3가부시키가이샤니콘내

마츠모토미호

일본도쿄도지요다쿠마루노우치3쵸메2-3가부시키가이샤니콘내

(74) 대리인

김창세

심사정구 : 없음

(54) 투영 광학계, 해당 투영 광학계를 구비한 투영 노광 장치및 투영 노광 방법

요약

본 발명은 짧은 초로(硝難) 길이와 적은 렌즈면 수를 갖고, 초기 상태뿐만 아니라 조명 조건이나 환경이 변화되었다고 해도 양호한 결상 성능을 유지하는 것을 목적으로 한다.

굴실형의 투영 광학계는, 제 1 먼 스측에서부터 순서대로, 부(원)의 제 1 렌즈군 G1과, 정(正)의 제 2 렌즈군 G2와, 부의 제 3 렌즈군 G3과, 제 4 렌즈군 G4와, 경의 제 5 렌즈군 G5를 구비한다. 투영 광학계의 렌즈먼의 유효 직정 또는 렌즈의 외경은 세 1 먼 A측으로부터 제 2 먼 B측으로 향하는 방향에 있어서, 제 1 렌즈군 G1에서는 단조 중가하고, 제 2 렌즈군 G2 중에서 증가로부터 감소로 향하는 정향을 갖고, 제 3 렌즈군 G3 중에서 감소로부터 중가로 향하는 정향을 가지며, 또한 제 5 민군 G5 중에서 반조 감소하는 구성을 취한다. 복수의 렌즈 중의 적어도 하나의 렌즈는 위치 및 자생 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지되고, 투영 광학계의 제 2 먼 B측의 계구 수는 G8 이상이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

PI. : 투영 광학계AX : 광축

G1: 제 1 렌즈군G2: 제 2 렌즈군

G3: 제 3 렌즈군G4: 제 4 렌즈군

G5: 제 5 렌즈군A: 제 1 면

B: 제 2 면W: 웨이퍼

R·레티콤

발명의 상세한 설명

밤명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 총래기술

본 발명은, 예전대 반도체 집적 회로, CCD 등의 활상 소자, 액경 디스플레이, 또는 박막 자기 해드 등의 마이크로 장치를 리소그래괴 기술을 이용하여 제조할 때에 이용되는 투영 노광 장치 및 방법, 해당 투영 노광 장치에 적합한 투영 광학계에 관한 것이다.

최근, 반도제 검적 회로 등의 마이크로 장치의 회로 페턴의 미세화에 따라, 스테퍼 등의 노광 장치에서 사용되는 노광용 조명광(노광광)의 파장은 해마다 단과장화해 오고 있다. 즉, 노광광으로서는, 종래 주로 사용되어 온 수은 밴르의 1년(파장: 365 m) 대신에 Krf 섹시미 레이저광(파장: 248 m)이 주류로 되어 오고 있으며, 또한 그것보다도 단과장의 Arf 섹시머 레이저광(파장: 193 m)도 실용화되어 있다. 또한, 다옥 노광광의 단과장화를 목적으로서, F 2 레이저(파 상: 157 m)와 작은 항로해 부가 레이저 독의 사용도 시도되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 자의 대역 또는 진공 자의 대역의 광원으로서는 상출한 역시가 레이커나 항로겐 분자 페이거 놓이 있지만, 자의 대역 또는 진공 자의 대역의 방사광을 투파시키는 제료가 한정되기 때문에, 투영 광학계를 구성하는 렌즈 소자의 제료 는 한정된 것밖에 사용할 수 없고, 이 한정된 제료의 투파율도 그 정도로 높은 것이 아니다. 그리고, 현 상태에서는, 렌 즈 소자의 표면에 마련되는 반사 방지 코트의 성능도 파장용의 것에 비하면 그다지 고성능인 것이 얻어지고 있지 않다. 또한, 최근에는, 조명 광학계에 의한 조명 조건의 변경이나 투영 광학계의 환경의 변동에 따라 투영 광학계의 결상 성능 의 변동을 역제하는 것이 요구되고 있다.

본 방명은, 이러한 사정을 간단하여 이루어진 것으로, 그 목적으로 하고자 하는 바는, 짧은 초로(解解) 길이와 적은 벤 즈 개수를 갖고, 초기 상태에서 양호한 결상 성능을 가질 뿐만 아니라, 조명 조건이나 환경이 변화되었다고 해도 양호한 결상 성능을 유지할 수 있는 투영 광학계를 제공하는 것에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 지극히 미세화된 투영 원판의 패턴 상(像)을 워크(work)에 양호하게 투영 노광할 수 있는 투영 노광 장치 및 투영 노광 방법을 제공하는 것에 있다.

발명의 구성 및 작용

또한, 본 발명의 제 3 투영 광학계의 바람식한 형태에 있어서는, 상기 제 4 엔즈군 중의 최대 유효 직장을 갖는 먼의 유 효 직정 또는 최대 외경을 갖는 렌즈의 외경을 Mx4라 하고, 상기 제 4 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 먼의 유효 직정 또는 최소 외경을 갖는 렌즈의 외정을 Mn4라고 할 때, (수학식 2) L ((地)起比(을 만족한다.

본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 제 1 랜즈군 내지 상기 제 4 렌즈군 각각의 렌즈군 중의 적어도 하나의 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조젓 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 제 1 면과 상기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈면 또는 최소 외정을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 상기 제 2 먼과 상기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈면 또는 최소 외정을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈 는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 제 1 면과 상기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈먼 또는 최소 의정을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 상기 제 2 먼과 상기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈먼 또는 최소 외정을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈 는 광축에 대하여 회전 비대칭인 렌즈먼을 갖고, 또한 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈 중의 상기 개구 조리개보다도 상기 제 1 면축에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈중의 상기 개구 조리개보다도 상기 제 2 면축에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈 중의 상기 개구 조리개보다도 상기 제 1 면측에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈중의 상기 개구 조리개보다도 상기 제 2 면축에 위치하는 적어도 하나의 렌즈난 광축에 대하여 회전 비대칭인 렌즈면을 갖고, 또한 위치 및 자세 중의 적어도 한축이 조정 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람적한 형태에 있어서는, 상기 제 1 현조군은 적어도 하나의 부(#) 현 스를 갖고, 상기 제 2 렌즈군은 적어도 하나의 부렌즈와 적어도 3개의 정(IE) 렌즈를 갖고, 상기 제 3 렌즈군은 적어도 2개의 부렌즈를 가지며, 상기 제 5 렌즈군은 적어도 4개의 자렌즈를 갖는다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈 중 의 적어도 하나의 렌즈는 비구면(非球面) 형상의 렌즈면을 갖는다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지된다.

또한, 본 발명의 제 1 내지 제 3 투영 광학계의 바람직한 형태에 있어서는, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈는 비구면 항상의 렌즈면을 갖는 계 1 비구면 렌즈와, 비구면 항상의 렌즈면을 갖는 제 2 비구면 렌즈를 적어도 갖고, 상기 제 1 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직정 또는 해당 렌즈의 실정을 D1, 상기 제 2 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직정 또 는 해당 렌즈의 외정을 D2라고 할 때, (수학식 3) [세]][세][세]

또한, 상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에 따른 투영 노광 장치는 투영 원판에 마련된 패턴의 상을 워크 상에 투영 노광하는 투영 노광 장치에 있어서, 노광광을 공급하는 광원과, 상기 광원으로부터의 노광광을 상기 투영 원판 상의 상 기 패턴으로 유도하는 조명 광학계와, 상기 기재된 투영 광학계를 갖고, 상기 제 1 면에 상기 투영 원판을 배치 가능하 게 하며, 상기 제 2 번에 상기 워크를 배치 가능하게 한 것이다. 또, 도 1~도 3의 에에서는 투영 광학계 증의 복수의 렌즈가 형성하는 공기 렌즈 중의 가장 제 1 면 A측에 배치되는 공 기 렌즈는 양(淸)불목 형상을 갖는다. 또한, 제 1 렌즈군 G1은 적어도 하나의 부렌즈를 갖고, 제 2 렌즈군 G2는 적어 도 하나의 부렌즈와 적어도 3개의 정렌즈를 갖고, 제 3 렌즈군 G3은 적어도 2개의 부렌즈를 가지며, 제 5 렌즈군 G5는 적어도 4개의 정렌즈를 갖는다.

그런데, 본 발명의 투영 광학계에서는, 제 2 렌즈군 G2 중의 최대 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경을 Mx2라 하고, 제 3 렌즈군 G3 중의 최소 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경을 Mn3이라 할 때, 이하의 수학식 1을 만족한다.

수학식 1

1. 7 < M × 2 / M n 3 < 4

수학식 1의 상한을 초과하면, 축외(軸外) 수차의 보정이 곤란하게 되고, 하한을 초과하면, 색 수차의 보정상 바람직하지 못하다. 더 바람직한 경계값으로서는 상한 3.2. 하한 1.85로 된다.

또한, 제 4 렌즈군 G4 중의 최대 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경을 Mx4라고 하고, 최소 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경을 Mn4라고 할 때. 이하의 수학식 2를 만족한다.

수학식 2

0.77<Mn4/Mx4<1

수학식 2는 색 수차 보정에 바람직한 제 1 면 A로부터 제 2 면 B까지의 사이에서 단지 하나가 현저한 극소를 갖는 광 학계의 구성을 규정하고 있다. 수학식 2를 만족하지 않는 경우, 색 수차 보정에 대하여 바람직하지 못하다. 더 바람직한 경제값은 하한이 0.8로 된다. 상한은 수학식이 최소/최대이므로, 1이 한계값으로 된다.

또한, 투영 광학계 중의 복수의 앤즈 중의 적어도 하나의 랜즈는 비구면 형상의 랜즈면을 갖는 것이 바람직하다. 이 비 구면의 작용에 의해, 초기의 결상 성능을 충분히 높이면서, 환경 변동에 대한 안정성과 충분한 투과율을 확보할 수 있다.

이 경우, 투영 창학체 중의 복수의 렌즈는 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 체 1 비구면 렌즈와, 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 체 2 비구면 렌즈를 갖는 것이 바람직하고, 체 1 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직장을 D1, 체 2 비구면 렌즈의 유 효 직장을 D2라고 할 때, 이하의 수학식 3을 만족하는 것이 바람직하다.

수학식 3

0.8<D1/D2<1.2

수학식 3은 투영 광학계에 마련되는 비구면의 직경이 현저히 과도하게 커지지 않는 구성을 규정하고 있다. 수학식 3을 만족하지 않는 경우에는, 투영 광학계에 마련되는 비구면의 직정이 현저히 과도하게 커져, 비구면 가공이 곤란하고, 경 우에 따라서는 불가능해지기 때문에, 투영 광학계의 제조상 바람직하지 못하다.

또한, 본 발명의 투영 광학계에서는, 복수의 렌즈 중의 적어도 하나의 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가 능례지도록 유지된다. 렌즈의 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽을 조정하는 것에 의해, 투영 광학계의 결상 특성을 보정할 수 있다.

또, 도 1 ~도 3의 에에서는, 제 1 렌즈군 G1, 제 2 렌즈군 G2 및 제 3 렌즈군 G3 각각의 렌즈군 중의 격어도 하나의 렌즈는 위치 및 자세 중의 작어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지된다. 또한, 제 1 먼 A와 제 2 렌즈군 G2 중의 최소 유 호 직경을 갖는 렌즈먼 또는 최소 외경을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 제 2 먼 B와 제 2 렌 즈군 G2 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈먼 또는 최소 외정을 갖는 렌즈와의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 제 4 렌즈군 G4는 제 1 면 A축에서부터 순서대로, 볼록면을 제 2 면 B축으로 향한 평볼록 형상의 정렌즈 L41과, 양 볼 록 형상의 정렌즈 L42와, 양 오목 형상의 부렌즈 L43, 양 볼록 형상의 정렌즈 L44를 갖는다.

제 5 렌즈군 CS는 제 1 면 A측에서부터 순서대로, 양 볼록 행상의 정렌즈 L51과, 볼록면을 제 1 면 A측에 향한 메니 스커스 항상의 3개의 정펜즈 L52~L54와, 팽팽 팽판 L55를 갖고 있다. 여기서, 경렌즈 L53의 제 2 면 B측의 렌즈먼 ASP4는 비구면 항상으로 항성되어 입다

도 2는 실시에 2에 따른 투영 광학계의 광로도이다. 본 실시에의 투영 광학계는 248.4 mm를 기준 과장으로 한 것이다. 또, 실시에 2에 있어서, 투영 광학계의 모든 광투과성 굴절 부제(렌즈 L11~L55)는 식영 유리(합성 석영)로 행성되어 있다

도 2에 나타내는 바와 같이, 십시에 2의 투명 왕학계는 계 1 면 소층에서부터 순서대로, 부의 균접대를 갖는 제 1 렌준 준 (3과, 경의 균절력을 갖는 제 2 렌즈는 C2와, 부의 균절력을 갖는 제 3 렌즈군 G3와, 광료 층에 개구 조리개 AS를 갖는 제 4 렌즈군 G4와, 경의 균절력을 갖는 제 5 렌즈군 G5를 구비하고 있다. 투영 광학계에서의 렌즈민의 유효 직경 은 제 1 년 A측으로부터 제 2 면 B속으로 황하는 방향에서, 제 1 렌즈군 G1에서는 단조 증가하고, 제 2 렌즈군 G2 층 에서 증가로부터 감소로 향하는 경향을 갖고, 제 3 렌즈군 G3 층에서 감소로부터 증가로 향하는 경향을 가지며, 또한 제 5 렌즈군 G5 층에서 단조 감소하는 구성으로 되어 있다. 또한, 제 2 렌즈군 G2 층에서 극대를 갖고, 제 3 렌즈군 G 3 층에서 감소를 갖고, 제 3 내지 제 5 렌즈군 G5 층에서 극대를 취하며, 또한 제 1 면 A으로부터 제 2 면 B까지의 사 미에서 단지 하나가 형자한 극소를 갖는 구선으로 되어 있다.

제 1 렌즈군 CI은 제 1 면 A흑에서부터 순서대로, 오목면을 제 2 면 B흑으로 향한 평오목 형상의 부렌즈 Lili와, 오목 면임 제 1 먼 A흑으로 향한 메니스카드 항상의 부렌즈 Lil2를 갖는다. 이를 부렌즈 Lili, Lil에 의해서, 양 불록 향상 면임 제 렌즈통 형성하고 있다. 여기서, 부렌즈 Lil의 제 2 면 B흑의 렌즈면 ASPI은 비구면 형상으로 형성되어 있다.

제 2 렌급군 (2는 제 1 면 A축에서부터 순서대로, 오목면을 제 1 면 A축으로 향한 메니스커스 행상의 2개의 부텐즈 L21, L22와, 양 불복 행상의 2개의 경렌즈 L23, L24와, 불폭면을 제 1 면 A축에 향한 메니스커스 행상의 2개의 경렌 즈 L25, L26을 갖는다. 여기서, 경렌즈 L26의 제 2 면 B축의 렌즈면 ASP2는 비구면 행상으로 행성되어 있다.

제 3 렌즈군 C3은 제 1 면 A축에서부터 순서대로, 양 오목 형상의 4개의 부렌즈 L31~L34와, 오목면을 제 1 면 A축으로 향한 메니스커스 형상의 부렌즈 L35를 갖는다. 여기서, 부렌즈 L34의 제 2 면 B축의 렌즈면 ASP3은 비구면 형상으로 형성되어 있다.

제 4 렌즈군 G4는 제 1 먼 A축에서부터 순서대로, 양 볼록 형상의 정렌즈 L41과, 볼록면을 제 1 면 A축으로 향한 메니스커스 형상의 2개의 정렌즈 I.42, I.43과, 양 볼록 형상의 정렌즈 I.44를 갖는다.

제 5 렌즈군 GS는 제 1 면 A측에서부터 순서대로, 오목면을 제 1 면 A측으로 향한 메니스커스 형상의 부렌즈 L51파, 볼록면을 제 1 면 A측으로 향한 메니스커스 형상의 4개의 경렌즈 L52~L55를 갖고 있다. 여기서, 경렌즈 L53의 제 2 면 B측의 렌즈면 ASP4는 비구면 형상으로 형성되어 있다.

도 3은 실시에 3에 따른 투영 광학계의 광로도이다. 본 실시에의 투영 광학계는 248.4 ms를 기준 파장으로 한 것이다. 또, 실시에 3에 있어서, 투영 광학계의 모든 광투과성 굴절 부재(렌즈 L11~L55)는 석영 유리(합성 석영)로 형성되어 있다.

도 3에 나타내는 바와 같이, 실시에 3의 투영 광학계는 제 1 먼 A측에서부터 순서대로, 부의 굴절력을 갖는 제 1 렌즈 군 G1과, 정의 굴절력을 갖는 제 2 렌즈군 G2와, 부의 굴절력을 갖는 제 3 렌즈군 G3과, 광로 중에 개구 조리기 AS를 갖는 제 4 렌즈군 G4와, 정의 굴절력을 갖는 제 5 렌즈군 G5를 구비하고 있다. 투영 광학계에서의 렌즈먼의 유효 직경 은 제 1 면 A속으로부터 제 2 면 B속으로 항하는 방향에서, 제 1 렌즈군 G1에서는 단조 증가하고, 제 2 렌즈군 G2 중 수학식 4

$$Z = \frac{c y^2}{1 + \sqrt{\left\{1 - (1 + \kappa)c^2 Y^2\right\}}} + C4 Y^4 + C6 Y^6 + C8 Y^8 + C10 Y^{10} + C12 Y^{12} + C14 Y^{14}$$

Z : 광속 방향의 제그

Y: 광축으로부터의 거리(직광 방향)

c : 면 전쟁에서의 꼬음(꼬음 반경의 역수)

#: 원조 계수(K) (구면의 경우, #=0)

C4,C6,C8,C10,C12,C14 : 비구인 계수

실시에 1 ~실시에 3 각각의 투영 광합계에서는 렌즈 재골(초재)로서 석영 유리(합성 석영)를 이용하고 있다. 각 실시 에에 있어서, 기준 파강 248.4 m에서의 석영 유리(합성 석영)의 굴절을, 파장 1 pm당 석영 유리의 굴절을의 변화량(분산) 및 석영 유리의 비충은 이하와 같다.

석영 유리의 굴절율 : 1.50839

석영 유리의 분산 : -5.6 × 10 -7 /+1 pm

석영 유리의 비중 : 2.2

또, 분산은 파장 +1 pm당 굴절율의 변화량을 나타내고 있고, 분산이 -5.6×10^{-7} /+1 pm이라는 것은, 파장이 기준 파장으로부터 +1pm만큼 변화한 경우에 굴절율이 5.6×10^{-7} 만큼 감소하는 것을 의미하고 있다.

이하의 표 1~표 3에 있어서, SfO₂는 석영 유리를 나타내고, NA는 제 2 먼 B 유의 제구 수, 수는 제 2 먼 B 상에서의 이미지 서를의 반쟁, 8 는 투영 광학제 전체의 투영 배울, 40은 제 1 먼 A로부터 가장 제 1 먼 A측의 광학면(랜르먼, 반사면)까지의 거리, WD는 가장 제 2 먼 B속의 광학면으로부터 제 2 먼 B까지의 거리(작동 거리)를 나타낸다. 또한, ASP1~ASP4는 비곡면을 나타내고, AS는 개구 조리개를 나타낸다. 또, 각 실시예에 대하여 공통으로, 투영 광학계의 제구 수 NA (제 2 면 B속의 개구 수), 투영 배울 6 및 제 2 면 B 상에서의 이미지 서울의 반경 6 는 이하와 같다.

NA = 0.82

 $\beta = 1/4$

 $\Phi = 13.2 \text{ mm}$

(班1)

설 ANR 1(도 1)
D 0 =6.23 (m)
D 10.48 (m)
교육 변경 정상 기계 위치 배구에 전조 전체 (m)
1: 00 25.00 (8), 111 12.4 (2) 2.2 (11.275 41.255 ASP) 142.1

```
32: -795.958 24.000 SiO<sub>2</sub>
                    L43 277.4
33: 278.236 27.029
                         274.5
34: 500.126 58.684
                      144 283.1
             SiO<sub>2</sub>
35: -393.024 10.492
                        286.0
36: 2955.500 32.879 SiO.
                      L51 285.8
37: -626.544 1.000
                         285.3
38: 201.110 49.960
                      L52 265.1
39: 730.074 1.000
                         256.6
40: 162.066 45.261
                      L53 223.7
41: 280,000 5,759
                  ASP4
                         201.3
42: 159.106 53.528
             S10<sub>2</sub>
                     154 177.4
43: 492.581 6.294
   ∞ 53,000
44:
             SiO+
                    LSS 125.0
45: ∞
                         56.4
[비구면 데이터]
< ASP1 >
            < ASP2 >
æ : 0.00000
             ≈ : 0.00000
C4 : -8.99872×10-** C4 : 1.00733×10-**
< ASP3 >
             < ASP4 >
κ : 0.00000
             κ : 0,00000
C4 : 4.32781×10-** C4 : -1.11168×10-**
```

(班 2)

```
21: -115.190 17.865
                     SiO<sub>2</sub>
                               L33 138.1
22: 3048, 133 14, 394
                                      159.5
23: -306.688 55.025
                                  L34 161.6
                                      215.5
24: 2288.537 12.262
                            ASP3
25: -3110.668 37.657
                                 L35 220.7
                      $10,
26: -238.147 1.000
                                     230.6
27: 2784.239 49.533
                                L41 262, 4(Mn4)
                      sio.
28: -261.060 1.000
                                     267.7
29: 301.548 50.456
                                L42 287.3(Hx4)
30: 2090.868 12.300
                                     284.1
                                 AS 282.3
31: ∞
            9.305
32: 9513,104 55,412
                               L43 281.2
                     SiO<sub>2</sub>
                                      276.1
33: 271.141 27.421
34: 462.725 50.112
                     $10,
                                L44 283.9
35: -564,778
             1.000
                                      285.6
36:-84302.567 34.086
                                L51 285.7
37: -509.897 1.000
                                      285.7
38: 200.575 46.481
                                 152 264.3
                     SiO,
39: 648,269
            1.007
                                      257.2
                                 L53 227.6
40: 169.530 35.871
                     SiO.
41: 279.942 8.224
                           ASP4
                                      214.2
42: 146.299 54.467 SiO:
                                 L54 182.4
43: 469.601 7.273
                                      139.5
44: 5116.633 58.229 Sig-
                              L55 132.2
45: 1153.136
                                      54.8
[비구면 테이터]
< ASP1 >
                 < ASP2 >
K : 0.00000 K : 0.00000
C4 : -9.38125×10<sup>-88</sup> C4 : 1.54761×10<sup>-08</sup>
```

```
C14 : 0.00000
    C14 : 0.00000
< ASP3 >
    < ASP4 >
κ : 0.00000
    κ : 0.00000
C4 : 4.46673×10-** C4 : -1.54863×10-**
```

39:	-367.624	1.000			286. 3(Hx4)
40:	230.000	40.103	SiO ₂	L51	286.2
41:	413.404	1.000			278.9
42:	234.229	41.871	SiO ₂	152	271.0
43:	803.282	3.792			264.1
44:	154.591	45.408	SiO ₂	L53	225.4
45:	395.911	7.175	ASP4		210.8
46:	138.759	47.541	Sio,	1.54	171.9
47:	261.540	10.750			128.4
48; -	-2223.234	49.636	SiO.	L55	122.9
49: -	-1482.603				59.4
[81:	구면 데이터	l			
< ASE	21 >		< SYZA >		
ĸ:	0.00000		r : 0.00000		
C4 : -1.22769×10-**			C4 : 5.48518×10 ⁻⁴⁴		
C6 : 3.91902×10-12			C6 : -3.71287×10-14		
C8 : 1.54573×10 ⁻¹⁶			C8 : -6.54689×10-1*		
C10 :	5.81458×	10-71	C10 : 1.54179>	10-**	
C12 :	0.00000		C12 : 0.00000		
C14 :	0.00000		C14 : 0.00000		
< ASE	3 >		< ASP4 >		
K :	0.00000		κ : 0.00000		
C4 :	2.48721×	10-46	C4 : 4.78408×	10-**	
C6 :	-2.70011×	10-12	C6 : 2.28738×	10-14	
C8 :	-1.40184×	10-16	C8 : -8.67747×	10-16	
C10 :	-2.90417×	10-21	C10 : 1.63825 >	10-11	
C12 :	0.00000		C12 : 0.00000		
C14 :	0.00000		C14 : 0.00000		

이하의 표 4 및 표 5에 실시에 1~실시에 3 각각의 조건 대응 수치를 나타낸다. 표 4에 있어서, Mx2는 제 2 렌즈군 중의 최대 유효 직정을 갖는 면의 유효 직정(mm), Mn3은 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 면의 유효 직정(mm)을 나타내고 있다. 또한, 표 5에 있어서, Mx4는 제 4 렌즈군 중의 최대 유효 직정을 갖는 면의 유효 직정(mm), Mn4는 제 4 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 면의 유효 직정(mm), Mn4는 제 2 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 면의 유효 직정(mm), D1은 제 1 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직정(mm), D2는 제 2 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직정(mm), D2는 제 2 비구면 렌즈의 엔즈인의 연구 대학교 있다.

(班 4)

	M x 2 (mm)	Mn 3 (ma)	Mx2/Mn3
실시에 1:	281.8	135.3	2.08
실시에 2 :	277.8	134.8	2.06
실시에 3:	277.5	132.0	2.10

이미지 필드의 단위는, 상술에 있어서 곡율 반경, 간격의 단위로서 빼올 채용한 경우에는 빼이다. 또, 본 실시에의 투영 광학계에서는 FWHM (full width at half maximum)에서 0.5 pm의 법위에서 여수가 보쟁이 이루어지고 있으며, 본 십시에의 투영 광학계를 노짥 작치에 내장하 있은에 노짥 작치의 광원이로의 부당을 저각하는 것이 가능하다.

상기 실시에 1~실시에 2의 투영 광학계는 도 10에 나타내는 실시에의 투영 노광 장치에 격용할 수 있다. 이하, 도 10 을 참조하여, 본 발명에 따른 노광 장치의 실시에에 대해 설명한다. 도 10은 실시에에 따른 투영 노광 장치의 개략 구성 을 도시하는 도면이다. 또한, 도 10에서는 XYZ 격교 좌표계를 채용하고 있다. XYZ 격교 좌표계는 워크(관광 시판) 로서의 웨이퍼 W를 유지하는 웨이퍼 스테이지(22)에 대하여 평행해지도록 X축 및 Y축이 설정되고, Z축이 웨이퍼 스테이지(22)에 대하여 격교하는 방향(두영 광학계 P1의 광축 AX에 팽행한 방향)으로 설정되고, Z축이 원예크는, 도먼 중의 XYZ 직교 자료계는 XY 됐더야 수됐어며 생해한 먼으로 설정되고, Z축이 위적(설胎)요 상황으로 설정되는

실시에에 따른 노광 강치는, 노광 광원으로서 KF 역시며 레이저 광원을 사용하고, 상기 실시에 1~실시에 3중 어느하나의 굴절형 투영 광하계를 투영 광하게 PL로서 사용하여, 본 발명을 적용한 것이다. 본 설시에 의투영 노광 강치에서는 레티를 R 상의 소경 형상의 조명 영역에 대하여 상대적으로 소정의 방향으로 레티를 R 및 웨이퍼 W를 농기하여 주사하는 것에 의해, 웨이퍼 W 상의 하나의 소트 영역에, 투영 원판으로서의 레티를 R의 패턴 상을 차차 적으로 전사하는 것에 의해, 웨이퍼 W 상의 하나의 소트 영역에, 투영 원판으로서의 레티를 R의 패턴 상을 차차 적으로 전사하는 스템・앤드 · 스캔 방식을 채용하고 있다. 이러한 스템・앤드 · 스캔 양기 보다 웨이퍼 W) 상의 영역에 레티를 R의 패턴을 노 개혁 수 보다 되는 기반에 웨이퍼 W) 상의 영역에 레티를 R의 패턴을 노 개혁 수 있는 생각을 채용하고 있다.

도 10에 있어서, 레이저 광원(2)은, 에컨대 발전 바꿍 248 m의 필스 자의광을 출력하는 KrF 에서머 레이저를 갖한다. 또, 본 실시예에서의 레이저 광원(2)으로서는 KrF 에서미 레이저에 한정되기 않고, 발진 파강 193 m의 ArF 에시미 레이저나, 파강 약 120 m= 악 180 m의 진공 자의 대역에 속하는 광을 발생하는 레이저, 에컨대 범진 파강 157 m의 불소다이머 레이저(F, 레이저)나, 발진 파강 146 m의 크리프론다이머 레이저(Kr₂ 레이저), 발진 파강 126 m의 아르 근다이머 레이저 (Ars 레이저) 등을 이용하더라도 무방하다.

그런데, 레이저 광원(2)으로부터의 型스 레이저광(조명광)은 편향 미러(3)에 의해 편향되어, 광로 지연 광학계(41)로 향하여, 레이저 광원(2)으로부터의 조명광의 시간력 가간섭 거리(고학이런스 길이) 이상의 광로 길이차가 부여된 시간 적으로 복수의 광속으로 분할된다. 또, 이러한 광로 지연 광학계는, 예컨대 일본 특허 공개 평성 제 1-198759 호 공보 나 일본 특허 공개 평성 제 11-174365 호 광보에 개시되어 있다.

광로 지연 광학계(41)로부터 사출되는 조명광은 광로 편향 미러(42)에 의해 편향된 후에, 제 1 플라이 아이 렌즈(43), 중 렌즈(44), 전동 미터(45)룏 순서데로 거쳐서 제 2 플라이 아이 렌즈(46)에 도달한다. 제 2 플라이 아이 렌즈(46) 의 사출측에는 유효 광원의 사이즈· 형상을 소망하는 형상으로 설정하기 위한 조명 광학계 개구 조리개용의 전환 리불 버(5)가 배치되어 있다. 본 예에서는 조명 광학계 개구 조리개에서의 광량 순실을 저감시키기 때문에, 중 렌즈(44)에 의한 제 2 플라이 아이 렌즈(46)로의 광속의 크기를 가변으로 하고 있다.

조명 광학계 개구 조리개의 개구로부터 사출한 광속은 콘텐서 렌즈군(10)을 거쳐서 조명 시야 조리개(레티클 블라인드) (11)를 조명한다. 또, 조명 시야 조리개(11)에 대해서는 일본 특허 공개 광성 제 4 - 196513 호 공보 및 이것에 대응 하는 미국 특허 제 5 473 410 호 공보에 개시되어 있다.

조명 시야 조리개(1) 로부터의 왕은 편향 미러(151, 154), 렌즈군(152, 153, 155)으로 이루어거는 조명 시야 조리 개 결상 광학계(레리를 불라인드 결상계)를 거쳐서 레티를 R 상에 유도되고, 레티를 R상에는 조명 시야 조리개((1)의 개구부의 상(盤)인 조명 영역이 형성된다. 레티를 R 상의 조명 영역에서의 광은 투영 광학계 PL을 거쳐서 웨이퍼 W 상 여기서, 케이스(40, 150, 170, 200) 작각에는 급기 밸브(147, 156, 171, 201)가 마린되어 있고, 이들 급기 밸브(1 47, 156, 171, 201)는 도시하지 않은 가스 궁급 장치에 접속된 급기판로에 접속되어 있다. 또한, 케이스(40, 150, 1 70, 200) 각각에는 배기 밸브(148, 157, 172, 202)가 마련되어 있고, 이를 배기 벨브(148, 157, 172, 202)는 각각 도시하지 않은 배기판로를 거쳐서 상기 가스 공급 장치에 접속되어 있다. 또, 가스 공급 장치로부터의 특정 가스는 도시 하지 않은 온도 조정 장치에 의해 소전의 목표 운도로 제어되어 있다. 여기서, 특정 가스로서 塑함을 이용하는 경우에는, 운도 조정 장치는 각 케이스의 근방에 배치되는 것이 바람건하다.

마찬가지르, 가스 치환실(174, 204)에도 금기 밸브(175, 205)와 배기 밸브(176, 206)가 마련되어 있고, 급기 밸브 (175, 205)는 급기관로를 거쳐서, 배기 밸브(176, 206)는 배기관로를 거쳐서 각각 상기 가스 공급 장치에 접속되어 있다. 또한, 무형 광학계 ID.의 정통에도 급기 벨브(181) 및 배기 벨브(182)가 마련되어 있고, 급기 벨브(181)는 도시 하지 않은 급기관로를 거쳐서, 배기 밸브(182)는 도시하지 않은 배기관로를 거쳐서 상기 가스 공급 장치에 접속되어 인다

또, 금기 벨보(147, 156, 171, 175, 181, 201, 205)가 마련된 급기관로와, 배기 벨보(148, 157, 172, 176, 182, 2 02, 206)가 마련된 배기관로에는 기문의 필터 또는 ULPA 필터 등의 이물질(파티클)을 제거하기 위한 필터와, 산소 등 의 홍수성 가스를 제거하는 화학적 필터가 마련되어 있다.

또한, 가스 치환실 (174, 204)에서는 레티를 교환 또는 웨이페 교환 시 등일 때에 가스 치환을 행할 필요가 있다. 예전 대, 레티를 교환 시에는, 도어 (174)를 열어 레티를 스토커(210)로부터 레티를을 가스 치환실(174) 내로 반입하고, 또 아(174)를 받아 가스 치환실(174) 내름 특정 가스로 체우고, 그 후, 도어(173)를 얻어 레티탈은 레티를 스테이지 RS 상에 탑재한다. 또한, 웨이퍼 교환 시에는, 도어(207)를 열어 웨이퍼를 가스 치환실(204) 내로 반입하고, 이 도어(207)를 얻어 가스 치환실(204) 내를 특정 가스로 체환다. 그 후, 도어(203)를 얻어 웨이퍼를 웨이퍼 홀더(20) 상에 탑재한다. 또, 웨티를 반출, 웨이퍼 반출의 경우는 이 반대의 숙서이다. 또, 가스 치환실(174, 204)로의 가스 치환 시에는 가스 치환실 내기를 감상한 후에, 금기 빨보로부터 특정 가스를 공급하더라도 무방하다.

또한, 케이스(170, 200)에서는, 가스 치환실(174, 204)에 의한 가스 치환을 행한 기세가 혼입된 가능성이 있어, 이 가스 치환실(174, 204)의 가스 중에는 상당한 양의 산소 등의 흡수 가스가 혼입되어 있을 가능성이 높기 때문에, 가스 치환실(174, 204)의 가스 치환과 동일한 타이밍에서 가스 치환을 행하는 것이 바람직하다. 또한, 케이스 및 가스 치환 실에서는 외부 분위기의 압력보다도 높은 압력의 특정 가스를 충전해 두는 것이 바람직하다.

그런데, 본 실시예에 있어서, 투영 광학계 PL을 구성하는 복수의 렌즈 중의 작어도 하나의 렌즈는 그 위치 및 자세 중의 작어도 한쪽이 조경 가능해지도록 유지되어 있다. 이것에 의해, 투영 광학계 PL의 결상 특성을 보정할 수 있다. 본실시예에서는, 투영 광학계 PL의 내외의 환경을 계측하고, 그 계측 결과에 근거하여, 투영 광학계 PL의 렌즈를 구동해서, 그 렌즈의 위치 및 자세 중의 작어도 한쪽을 조정하여, 투영 광학계 PL의 절상 특성을 보정한다.

도 11은 상숙한 결상 특성의 보정에 관한 제어 블럭도이다.

왕)으로의 이동, 및 '옷속에 평평한 축 주위 및 'Y축에 생평한 축 주위의 틸트를 행함으로써, 그 소경수의 종류의 수차를 개법적으로 보정하는 것이 가능해진다. 본 실시에에서는, 특영 광학계 DL 중의 5개의 웹즈에 대해, 그 중의 하나의 렌즈의 위치 및 자세를 정하는 것에 의해, 또는 그 중의 복수의 렌즈의 위치 및 자세를 서로 관련지이 조정하는 것에 의해, 비용, 왜곡(생곡 수차), 코마 수차, 상번(條面) 만콕 수차 및 구면 수차를 개별적으로 보정할 수 있다. 또, 상술한 렌즈의 위치 및 자세의 조정에 의해서 수차를 보정하는 기술에 대해서는, 여전대 일본 특히 공개 평성 제 11-195602 호 공보 등에 개시되어 있다. 또한, 간축 방향(광축 AX 방향)으로의 이동, 및 X축에 평향한 축 주위 및 무축이 기급에 대해서는, 예전에 설심 등이 등이 명하는 지수에 설심하는 기구에 대해서는, 역사 및 일본 특히 공개 평성 제 10-206714 호 및 일본 특히 공개 평성 제 11-44834 호 등의 각 공보에도 개시되어 있다. 또한, X축에 평향한 축 주위의 및 ۲축에 평향한 축 주위의 밀트를 실행하는 기구에 대해서는, 일본 특히 공개 제 2000-235134 호 공보 및 일본 특히 공개 제 시대되어 있다.

또한, 투영 광학계의 결상 투성을 보정하기 위한 렌즈의 위치 및 자세의 조정은 상출한 2후 방향(관측 AX 방향)의 렌즈의 위치, 및 X축에 평행한 축구위 및 Y축에 평행한 축구위의 필트의 조정에 한정되지 않는다. 즉, 상출한 자세의 조성에 부가하여, 투영 확합에 ID, 중의 복구의 벤즈 중의 적어도 하나의 렌즈를 광축에 수가진 XY인 내에서 이동(시포트)시켜 그 렌즈의 핀심을 조정하는 것이 바람쥐하다. 여기서, 렌즈의 위치 및 자세의 조정에 있어서, 건술한 Z축 방향(공축 AX 방향)의 위치 및 자세의 전에 행행한 축구위 및 Y축에 평행한 축구위의 및단원 조정하는 수단을 제 조정 수단, 공중에 숙기 XY만 대에서의 집조의 위치를 조정하는 수단을 제 2 조정 수단이라고 부르기로 한다.

제 2 조정 수단에 의한 렌즈의 위치 조전에 있어서, 제 1 조정 수단에서 위치 및 자세를 조정하는 렌즈와는 다른 렌즈화 조정 대상으로 하는 것이 바람직하다. 또한, 투영 광학계 중의 복수의 렌즈 중, 적어도 2개의 렌즈를 판련지어 동시에 조정하는 것이 바람직하다, 제 2 조정 수단에 의한 렌즈의 위치 조정은 제 1 조정 수단에 의한 전조의 의례서 보정할 수 없었던 투영 광학계의 결상 특성의 관류 생분을 보정하는 것을 주면 목적으로 하고 있다. 즉, 제 1 조정 수단에 의한 전조의 의치의 조정을 조합하여 행한으로써, 투영 광학계의 결상 특성을 보다 고정밀도로 보정할 수 있다. 또, 제 2 조정 수단도 제 1 조정 수단과 마찬가지로, 투영 광학계 내외의 환경을 보다 고정밀도로 보정할 수 있다. 또, 제 2 조정 수단도 제 1 조정 수단과 마찬가지로, 투영 광학계 내외의 환경을 보는 기본적인 기구로 선수 연합 인간에 인한 인공 기본적인 기구로 선수 연합 인간에 인한 인상 기본 전상 인간에 기구로 선수 연합 인간에 인상 기계 제 2000 - 206385 호 공보에 개시된 기술을 이용할 수 있다.

또한, 상숙한 제 1 조정 수단 및 제 2 조정 수단에 의한 렌즈의 위치 및 자세의 조정에 부가하여, 투영 광학계 중의 복수의 렌즈 중, 광축에 대하여 회전 비대칭인 렌즈면을 갖는 적이도 하나의 렌즈를, 광축을 중심으로 회전시켜 그 렌즈의 최전 위치를 조정하는 것이 바람식하다. 여기서, 이 렌즈의 회전 위치를 조정하는 수단을 제 3 조정 수단이라고 부르기로 한다. 이 제 3 조정 수단에 의해, 투영 광학계의 센터 접지 성분이나 비동방적 왜곡을 보정할 수 있다. 여기서, 센터 접지 성분이란, 투영 광학계의 투영 영역의 중상에서 발생하는 접지 성분이다. 또한, 비동방적 왜곡이란, 검상 배율이상면 내외 소정의 자오선 방향과 이것에 직교하는 자오선 방향과 선수 상한 수차를 말한다. 또, 광축에 대하여 최전 비대 정인 렌즈덴에서는, 예컨대 X축 방향의 곡을과 Y축 방향의 곡을이 다른 트덕면을 이용할 수 있다.

여기서, 트릭면이 형성된 렌즈를 이용하여 센터 접지 성분을 보정하는 원리에 대하여 간단히 설명한다. 도 14는 센터 접지 성분을 보정하는 원리를 실명하기 위한 도민이다. 도 14에 있어서, 렌즈(320, 321)는 투영 광하계 PL을 구성하는 렌즈 중의 일부 렌즈(320, 321) 중의 적어도 한쪽은 광충 AX를 중심으로 하여 최진 가능하게 마린 되어 있다. 그리고, 렌즈(320, 321)는 각각 곡을 반경이 가장 강한 방향(320A, 321A)과, 이들 방향(320A, 321A)과 리교한 방향(320A 학생 곡을 반경이 가장 악한 방향(320A, 321A)과, 이들 방향(320A 학생)으로서 각각 곡을 반경이 가장 악한 방향(320B, 321B)을 갖고 있다. 여기서, 도면 중 실선으로 나타내는 방향(320B, 321B)의 교육 환경이 가장 악하게 되고, 도면 중 파선으로 나타내는 방향(320B, 321B)에서는 렌즈(320, 321)의 굴실력이 가장 악해진다. 또, 이하에 있어서는, 곡을 반경(굴절박)이 가장 악하게 되는

렌즈 I.42 및 정렌즈 I.43에 대하여. 제 3 조정 수단(402)에 의해 회전 위치의 조정이 가능하다.

즉 본 실시예에서는 도 15~도 17에 나타내는 각 투영 광학계 PL에 있어서, 제 1 렌즈군 G1~제 4 렌즈군 G4 각각 의 렌즈군 중의 적어도 하나의 렌즈는 제 1~제 3 조정 수단(400~402) 중 어느 하나의 조정 수단에 의해 위치 또는 자세의 조정이 가능하다 또한 제 1 면 A와 제 3 렌즈군 G3 중의 최소 유효 직경을 갖는 렌즈면과의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 제 2 면 B와 제 3 렌즈군 G3 중의 최소 유효 직경을 갖는 렌즈면과의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 제 1~제 3 조정 수단(400~402) 중 어느 하나의 조정 수단에 의해 위치 또는 자세의 조정이 가능하다. 또한, 제 1 면 A와 제 3 렌즈군 G3 중의 최소 유효 직경을 갖는 렌즈면과의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 제 2 면 B와 제 3 렌즈군 G3 중의 최소 유효 직정을 갖는 렌즈면과의 사이에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 광축에 대하 여 회전 비대칭인 렌즈면을 갖고, 제 3 조정 수단(402)에 의해 회전 위치의 조정이 가능하다. 또한, 투영 광학계 PL 중 의 복수의 렌즈 중의 개구 조리개 AS보다도 제 1 면 A층에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 투영 광학계 PL 중의 복수 의 렌즈 중의 개구 조리개 AS보다도 제 2 면 B측에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 제 1~제 3 조정 수단(400~402) 중 어느 하나의 조정 수단에 의해 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽의 조정이 가능하다. 또한. 투영 광학계 PL 중의 복수 의 렌즈 중의 개구 조리개 AS보다도 제 1 면 A측에 위치하는 적어도 하나의 렌즈와, 투영 광학계 PL 중의 복수의 렌즈 줄의 개구 조리개 AS보다도 제 2 면 B측에 위치하는 적어도 하나의 레즈는 광축에 대하여 회전 비대첫인 렌즈면욥 갖 고, 제 3 조정 수단(402)에 의해 회전 위치의 조정이 가능하다. 또한, 무영 광학계 PL 중의 복수의 렌즈 중의 비구면 형상의 렌즈면(ASP2)을 갖는 렌즈 중의 적어도 하나의 렌즈는 제 1 조정 수단(400)에 의해 위치 및 자세의 조정이 가 능하다. 그리고, 렌즈의 위치 및 자세를 조정하는 것에 의해, 투영 광학계 PL의 결상 특성을 보정할 수 있다.

특히, 본 실시에에서는, 투영 광학계 PL 내외의 환경을 계측하고, 그 계측 절파에 근거하여, 그 랜드의 위치 및 자세 중 의 적이도 한쪽을 조정해서, 투영 광학계 PL의 결상 특성을 보정하는 것이므로, 환경 조건의 변화에 따른 투영 광학계 PL의 점상 특성의 변동을 여제할 수 있다.

그런데, 투영 광탁계 PL의 검상 특성을 보정하는 방법으로서는, 상술한 벤즈의 위치 및 자세의 조정을 하는 것에 한경 되지 않고, 예컨대 이전의 도 15~도 17 중에 나타내는 바와 같이 투영 광학계 PL의 웨이퍼 W측이나 투영 광학계 PL의 레타를 R축에 평행 평면관(330)을 설치하고, 도시하지 않은 구동부름 거처서 이 평행 평면관(330)을 살치하고, 도시하지 않은 구동부름 거처서 이 평행 평면관(330)을 살치하고, 도시하지 않은 가동부름 거처서 이 평행 평면관(330)을 살치하고, 도시한 요절이 형성된 평행 평면관을 이용하는 것에 의해, 투영 광학계 PL의 진제(全系)가 갖고 있는 수차 중에서도 특히 해극(해곡 수차)의 비화진 대상 성분을 보정하는 것이 기능해진다. 또는, 투영 광학계 PL의 웨이퍼 쌍측에 팽행 평면관을 설치하고, 이 팽행 평면관의 Z축 방향의 위치나 경사각을 조정하는 것에 의해, 편성 코마 수차를 보정하는 것이 가능해진다.

또한, 예련대 일본 특히 공개 평성 계 9-329742 호 공보 등에 개시되어 있는 바와 같이, 투명 광학계 PL의 웨이퍼 W 후 또는 레티클 R우의 광료 중에 배치되는 광학 부재(예원대, 또 15~도 17 중에 나타내는 평행 패런판(330)의 작어 도 한쪽의 면의 파워를 변화시켜, 투명 광학계 PL의 결상 특성을 보정하더라도 된다. 이 경우, 파워가 상이한 광학 부재 를 교환하는 것에 의해, 상기 파워를 조정하도록 하면 면다. 이것에 의해, 투영 광학계 PL의 텔레센트덕성에 영황을 미 치게 하는 일없이, 성면 반복 구차를 당초하게 보정할 수 있다.

또한, 투영 광학계 PL의 결상 특성을 보정하는 방법으로서는, 렌즈나 평행 평면판 등의 광학 부채의 위치나 자세를 번 정시키는 방법 의에, 노광광의 광원(레이저 광원)의 발진 파장을 변화시키는 기술이 알려져 있다. 예컨대, 일본 특허 공 개 평성 제 11 - 352012 호 공보 및 일본 특허 공개 제 2000 - 75493 호 공보에는 대기의 굴절율이 번정되는 것에 기 인하는 결상 특성 변동을 저갑시키는 기술이 개시되어 있다. 또한, 예컨대 일본 특히 공개 평성 계 7 - 245251 호 광보 등에는 광원의 받지 과장을 시포트시키는 것에 의해 작곡적으로 투영 광학계의 결상 특성을 보정하는 기계시되어 도 20에 있어서, 패턴 형성 공정(단계 901)에서는, 본 실시에의 노광 장치를 이용하여 레티컬의 패턴을 감광성 기관(레지스트가 도포된 유리 기관 등)에 전사 노광하는, 소위 광 리스 교래의 공정이 실행된다, 이 광 리스고객이 공정이 의행 사이 관 리스고객이 공정이 의해서, 감광성 기관 상에는 다수의 천극 등을 포함하는 소정 패턴이 형성된다. 그 후, 노광된 기관은 현상 공정, 예정 공 정, 레티블 박리 공정 등의 각 공정을 거원으로써, 기관 상에 소정의 패턴이 형성되고, 다음 컬러 필터 형성 공정(단계 902)으로 이행한다.

다음에, 컬러 필터 형성 공성(단계 902)에서는, R(Red), G(Green), B(Blue)에 대응한 3개의 도트의 세트가 매트릭 스 형상으로 다수 배열된 컬러 필터를 행성한다. 그리고, 컬러 필터 형성 공정(단계 902) 후에, 센 조립 공정(단계 90 3이 실행된다.

셀 조립 공정(단계 903)에서는, 패턴 형성 공정(단계 901)에 의해 얻어진 소정 패턴을 갖는 기판, 및 컬러 필터 형성 공정(단계 902)에 의해 얻어진 퀄리 필터를 등을 이용하여 액정 패틸(액정, 생)을 조립한다. 셸 조립 공정(단계 903)에서는, 에컨대, 페턴 형성 공정(단계 901)에 의해 얻어진 소정 패턴을 갖는 기관과 컬러 필터 형성 공정(단계 902)에 의해 얻어진 컨터 필터와의 사이에 액정을 추입하여 액정 패틸(액정 생)을 제조한다.

그 후, 모듈 조법 공정 (단계 904)에서, 조립된 액정 배일(액정 셈)의 표시 동작을 실행시키는 전기 회로, 백 라이트 등 의 각 부품은 부착하여 액정 표시 소자로서 안성시킨다. 상술한 액정 표시 소자 제조 방법에 따르면, 지극히 미세한 회 로 패터용 같아 백정 표시 소자를 스무푸 흑게 얻을 수 있다.

그런데, 상기 도 10의 실시에에서는, 조명 광학계 중의 광학 객본기(유니포마이저, 호모지나이저)로서 플라이 아이 엔 조(43, 46)을 이용하고 있지만, 13억 기판 위에 복수의 렌즈면운 애칭 등의 방법에 의해 형성한 마이크로 플라이 아이 엔즈를 이용하더라도 된다. 또한, 제 1 플라이 아이 엔조(43) 대신에, 최절 작용에 의해 입사광을 발산시키고 그 과 필드(프라운호퍼 회절 영역)에서 원형 상, 고리띠 형상, 다중 극 형상의 조야를 형성하는 회절 광학 소자를 이용하다라도 된다. 또, 이러한 최절 광학 소자를 사용하다라도 된다. 또, 이러한 최절 광학 소자를 사용하다가 되었다. 바로 인다. 또, 이러한 최절 광학 소자를 이용하는 경우에는, 공로 지면 용학계(시)를 생략하다로 무방하다.

또한, 광학 적분기로서는, 내면 반사형 적분기(로드· 적분기, 광 파이프, 광 터널 등)를 이용하는 것도 가능하다. 이리 한 내면 반사형 격분기를 이용하는 경우에는, 내면 반사형 격분기의 사을면과 레티클의 패턴면이 거의 공역으로 된다. 따라서, 도 10의 실시에에 작용하는 경우에는, 에컨대 내면 반사형 적분기의 사흘런에 근접시켜 조명 시야 조리개(레티 를 불라인드)(11)를 배치하고, 제 1 플라이 아이 렌즈(43)의 사흙먼과 내면 반사형 적분기의 입사면을 거의 공역으로 하도록 중 해군(44)을 구성하다. 된다. 디바이스 패턴을 유리 플레이트 상에 전사하는 노광 장치, 박막 자기 해드의 제조에 이용되며, 장치 패턴을 세라 및 웨이퍼 상에 전사하는 노광 장치, 활상 소자(CCD 등)의 제조에 이용되는 노광 장치 등에도 본 발명을 적용할 수 있 다. 또한, 레티클 또는 마스크를 제조하기 위해서 유리 기관 또는 실리콘웨이퍼 등에 최로 패턴을 전사하는 노광 장치에 도 본 발명을 적용할 수 있다

이상, 정부 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 바람직한 실시에에 대하여 설명했지만, 본 발명은 이러한 예에 한정되지 않는 것은 말할 필요도 없다. 당업자라면, 특허청구범위에 기재된 기술적 사상의 범위 내에서, 각종 변경에 또는 수정에 에 상도(經到)할 수 있는 것은 분명하고, 그것들에 대해서도 당인히 본 발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 이해해야 한 것이다.

방명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면, 짧은 초로 길이와 적은 렌즈면 수를 갖고, 초기 상태에서 양호한 결상 성능을 가결 뿐만 아니라, 조명 조건이나 환경이 변화되었다고 해도 양호한 결상 성능을 유지할 수 있는 투영 광학계를 제공할 수 있다

또한, 본 발명에 의하면, 지극히 미세화된 투영 원판의 패턴의 상을 워크 상에 양호하게 투영 노광 가능한 투영 노광 장 치 및 투영 노광 방법을 제공할 수 있어. 미세한 회로 패턴을 고해상로 형성할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

복수의 렌즈를 거쳐서 제 1 면의 상(像)을 제 2 면 상에 투영하는 투영 광학계에 있어서.

삿기 제 1 면과 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 부(名)의 굴절력을 갖는 제 1 렌즈군과

상기 제 1 렌즈군과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 정(正)의 굴절력을 갖는 제 2 렌즈군과,

상기 제 2 렌즈군과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 부의 굴절력을 갖는 제 3 렌즈군과,

삿기 제 3 렌즈군과 삿기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치된 제 4 렌즈군과.

삿기 제 4 렌즈군과 삿기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 것의 굴절력를 갖는 제 5 렌즈군

을 포함하되.

거기에서, 상기 투영 광학계에서의 렌즈면의 유효 작경 또는 렌즈의 의경은, 상기 제 1 면촉으로부터 상기 제 2 면촉으 로 향하는 방향에서, 상기 제 1 렌즈군에서는 단조 증가하고, 상기 제 2 렌즈군 중에서 증가로부터 감소로 향하는 경향 을 갖고, 상기 제 3 렌즈군 중에서 감소로부터 증가로 향하는 경향을 가지며, 또한 상기 제 5 렌즈군 중에서 단조 감소 하는 구성을 위하고,

상기 제 2 렌즈군 중의 최대 유효 직정을 갖는 면의 유효 직경 또는 최대 외경을 갖는 렌즈의 외경을 Mx2라고 하고, 상 기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직정을 갖는 면의 유효 직경 또는 최소 외경을 갖는 렌즈의 외경을 Mn3이라고 할 때,

(수학식 1)

1.7<Mx2/Mn3<4

투영 광학계.

첫구항 4.

제 3 항에 있어서.

상기 제 3 렌즈군과 상기 제 2 면 사이에 위치하는 개구 조리개를 더 포함하는 투영 광학계.

청구항 5.

복수의 렌즈를 거쳐서 제 1 면의 상을 제 2 면상에 투영하는 투영 광학계에 있어서

상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 부의 굴절력을 갖는 제 1 렌즈군파,

상기 제 1 렌즈군과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 정의 굴절력을 갖는 제 2 렌즈군과,

삿기 제 2 렌즈군과 삿기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 부의 굴절력을 갖는 제 3 렌즈군과

상기 제 3 렌즈군과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 광로 중에 개구 조리개를 갖는 제 4 렌즈군과,

상기 제 4 렌즈군과 상기 제 2 면 사이의 광로 중에 배치되고 정의 굴절력을 갖는 제 5 렌즈군

을 포함하되,

거기에서, 상기 투명 광학계 중의 상기 복수의 렌즈의 렌즈면의 유효 직정 또는 상기 복수의 렌즈의 의정은, 상기 제 2 렌즈군 중에서 극대를 갖고, 상기 제 3 렌즈군 중에서 극소를 갖고, 상기 제 3 내지 제 5 렌즈군 중에서 극대를 갖는 구 성을 취하며, 또한 상기 제 1 면으로부터 상기 제 2 면까지의 사이에서 단지 하나가 현저한 극소를 갖고,

상기 복수의 렌즈 중의 적어도 하나의 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지되며,

상기 투영 광학계의 상기 제 2 면족의 개구 수는 0.8 이상의 개구 수를 갖는

투영 광학계.

첫구항 6.

제 5 항에 있어서.

상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈가 형성하는 공기 렌즈 중의 가장 제 1 면측에 배치되는 공기 렌즈는 양(兩) 볼록 형상을 갖는 투영 광학계.

첫구항 7

제 6 항에 있어서.

상기 제 2 렌즈군 중의 최대 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경 또는 최대 외경을 갖는 렌즈의 외경을 Mx2라고 하고, 상 기 제 3 렌즈군 중의 최소 유효 직경을 갖는 면의 유효 직경 또는 최소 외경을 갖는 렌즈의 외경을 Mn3이라고 할 때,

(수학식 1)

청구항 13.

제 12 항에 입어서

상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 랜즈 중의 상기 개구 조리개보다도 상기 체 1 면축에 위치하는 적어도 하나의 렌즈 와, 상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈 중의 상기 개구 조리개보다도 상기 체 2 면축에 위치하는 적어도 하나의 렌즈는 광축에 대하여 회전 비대칭인 렌즈면을 갖고, 또한 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지되 는 투영 광학계.

청구항 14.

제 13 항에 있어서.

상기 제 1 렌즈군은 적어도 1개의 부렌즈를 갖고.

상기 제 2 렌즈군은 적어도 1개의 부렌즈와 적어도 3개의 정렌즈를 갖고,

상기 제 3 렌즈군은 적어도 2개의 부렌즈를 갖고,

상기 제 5 렌즈군은 적어도 4개의 정렌즈를 갖는

투영 광학계.

청구항 15.

제 14 항에 있어서.

상기 무영 팡화게 중의 상기 복수의 레즈 중의 적어도 하나의 렌즈는 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 투영 광화계.

청구항 16.

제 15 항에 있어서.

상기 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 렌즈는 위치 및 자세 중의 적어도 한쪽이 조정 가능해지도록 유지되는 투영 광학계.

청구항 17.

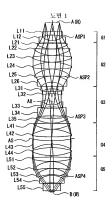
제 16 항에 있어서,

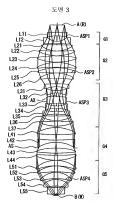
상기 투영 광학계 중의 상기 복수의 렌즈는, 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 제 1 비구면 렌즈와, 비구면 형상의 렌즈면을 갖는 제 2 비구면 렌즈를 적어도 갖고,

상기 제 1 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직경 또는 해당 렌즈의 외경을 D1, 상기 제 2 비구면 렌즈의 렌즈면의 유효 직 경 또는 해당 렌즈의 외경을 D2라고 할 때.

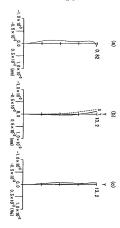
(수학식 3)

0.8<D1/D2<1.2

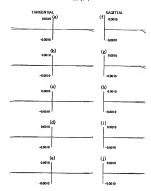




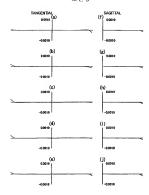


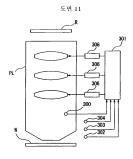


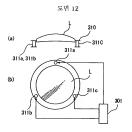
도면 7



도면 9

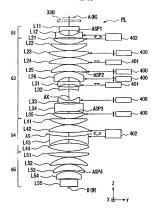




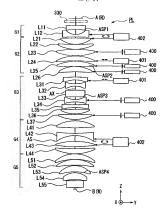




도면 15



도면 17



도면 18

